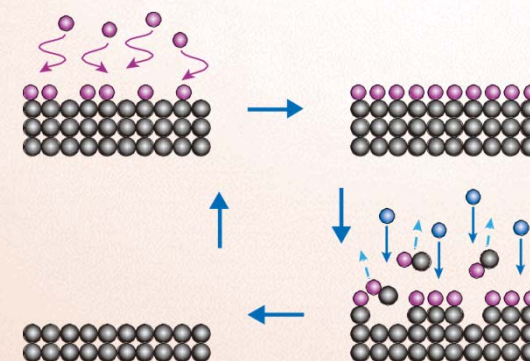


# 第79回応用物理学会秋季学術講演会シンポジウム 「アトミックレイヤープロセスの現状と展望」

日時: 2018年9月20日(木) 13:30-19:00(予定)

会場: 名古屋国際会議場(応用物理学会会場内)

半導体デバイスの微細化・高度化に伴い、原子レベルでの3次元微細加工技術が不可欠となってきました。原子1層ごとに堆積や除去を行う原子層堆積(ALD)法や原子層エッチング(ALE)法はその唯一解として高く注目されています。本シンポジウムでは、国内外、産学官の垣根なく研究者が一堂に会し、表面化学・反応工学を基にした根本原理から最新のデバイス応用までを広く議論したいと思います。



## 【招待講演者】

ALE 浜口 智志(大阪大学)

Peter L.G. Ventzek(TEL America)

豊田紀章(兵庫県立大)

堤 隆嘉(名古屋大学)

ALD 霜垣 幸浩(東京大学)

Hyeongtag Jeon(Hanyang Univ.)

片山 雅之(デンソー)

山崎 隆浩(大阪大学)

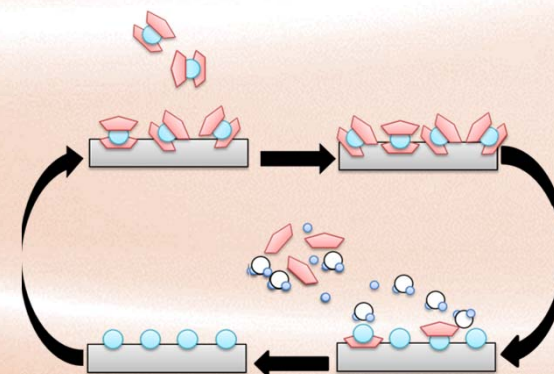
## 【世話人】

百瀬 健(東京大学)

関根 誠(名古屋大学)

唐橋 一浩(大阪大学)

入沢 寿史(産総研)



※一般講演募集中(6月26日17時締切)